

Вакуумная установка электронно-лучевого испарения
предназначена для нанесения металлических плёнок
на полупроводниковые пластины



Технологические характеристики:

Выполнена в соответствии с требованиями заказчика:

- Ручная загрузка образцов;
- 2 типа подложкодержателей: 30 мест для размещения образцов диаметром до 50 мм или 10 мест для размещения пластин диаметром 100 мм;
- Нагрев образцов до 300 градусов;
- Вакуумная камера из нержавеющей стали с возможностью охлаждения и нагрева стенок;
- Предельное остаточное давление 10^{-6} Торр;
- Криогенный насос для создания глубокого вакуума;
- Количество электронно-лучевых испарителей: 2;
- Объем тигля в каждом испарителе 100 см^3 ;
- Заслонка для каждого испарителя;
- Система контроля толщины напыляемых слоев;
- Автоматический режим работы установки;
- Чиллер в комплекте с установкой.

